

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成24年8月16日(2012.8.16)

【公開番号】特開2011-149098(P2011-149098A)

【公開日】平成23年8月4日(2011.8.4)

【年通号数】公開・登録公報2011-031

【出願番号】特願2010-288000(P2010-288000)

【国際特許分類】

C 23 F 11/00 (2006.01)

【F I】

C 23 F 11/00 C

C 23 F 11/00 B

【手続補正書】

【提出日】平成24年7月2日(2012.7.2)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

銅箔の少なくとも片面に電気二重層容量の逆数(1/C)値が0.3~0.8 cm²/μFである有機防錆皮膜が形成されている表面処理銅箔。

【請求項2】

前記銅箔の有機防錆皮膜が形成される面の表面粗さが、JIS B 0601-1994で規定する10点平均粗さ(Rz)で2.0 μm以下である請求項1に記載の表面処理銅箔。

【請求項3】

前記有機防錆皮膜がトリアゾール化合物、ジカルボン酸類、アミン類とで形成されることを特徴とする請求項1に記載の表面処理銅箔。

【請求項4】

前記有機防錆皮膜がテトラゾール化合物、ジカルボン酸類、アミン類とで形成されることを特徴とする請求項1に記載の表面処理銅箔。

【請求項5】

銅箔の少なくとも片面に電気二重層容量の逆数(1/C)値が0.3~0.8 cm²/μFである有機防錆皮膜を、銅箔表面にトリアゾール化合物、ジカルボン酸類、アミン類を含有する溶液を接触、乾燥させて形成する表面処理銅箔の製造方法。

【請求項6】

銅箔の少なくとも片面に電気二重層容量の逆数(1/C)値が0.3~0.8 cm²/μFである有機防錆皮膜を、銅箔表面にテトラゾール化合物、ジカルボン酸類、アミン類を含有する溶液を接触、乾燥させて形成する表面処理銅箔の製造方法。

【請求項7】

JIS B 0601-1994で規定する10点平均粗さ(Rz)が2.0 μm以下である銅箔の少なくとも片面に電気二重層容量の逆数(1/C)値が0.3~0.8 cm²/μFである有機防錆皮膜を、銅箔表面にトリアゾール化合物、ジカルボン酸類、アミン類を含有する溶液を接触、乾燥させて形成する表面処理銅箔の製造方法。

【請求項8】

JIS B 0601-1994で規定する10点平均粗さ(Rz)が2.0 μm以下であ

る銅箔の少なくとも片面に電気二重層容量の逆数(1/C)値が0.3~0.8 c m² / μFである有機防錆皮膜を、銅箔表面にテトラゾール化合物、ジカルボン酸類、アミン類を含有する溶液を接触、乾燥させて形成する表面処理銅箔の製造方法。